ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ МИКРО И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО HfB₂

<u>Д.Ю. Ковалев¹</u>, С.П. Шилкин², С.В. Коновалихин¹, Г.В. Калинников², И.И. Коробов², С.Е. Кравченко², Н.Ю. Хоменко¹, Р.А. Андриевский²

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, Черноголовка, Россия ² Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук,, Черноголовка, Россия

* kovalev@ism.ac.ru

Введение

Диборид гафния HfB₂ является высокотемпературным керамическим материалом, обладающим уникальным комплексом свойств [1-2]. Благодаря высокой температуре коррозионной стойкости и твердости он является перспективным плавления, конструкционным материалом для тепловой защиты гиперзвуковых летательных аппаратов [3,4]. В современном материаловедении прослеживается тенденция создания материалов с наноразмерными структурными составляющими. Переход в наноструктурное состояние приводит к значительному повышению механических свойств и других характеристик, приводя к расширению области применения материала. Обзор работ по синтезу, свойствам и стабильности наноструктурных TiB₂, ZrB₂ и HfB₂, проведенный в [5], показал ограниченность сведений о теплофизических свойствах этих объектов. Важным с эксплуатационной точки зрения свойством диборидов является величина коэффициента теплового расширения (КТР), его анизотропия и температурная зависимость. Сведения о величинах КТР диборидов титана, циркония и гафния исчерпываются данными для крупнокристаллических объектов [6-8]. Вместе с тем, известно, что материалы в нанокристаллическом состоянии обладают большими значениями КТР по сравнению с крупнокристаллическими аналогами.

Целью настоящей работы является исследование методом высокотемпературной рентгеновской дифракции нанокристаллического диборида гафния и определение температурной зависимости коэффициента термического расширения.

Методика эксперимента

Объектами исследования являлись наноразмерный и микрокристаллический порошки HfB₂. Нанодисперсный порошок HfB₂ был получен при взаимодействии HfCl₄ с NaBH₄ при мольном соотношении 1:10 в течение 15 часов при температуре 1000К в реакторе – автоклаве [9]. По результатам химического и энергодисперсионного анализов диборид гафния имеет состав HfB_{2.02}. Удельная поверхность полученного порошка HfB₂ составила S_{уд} = 30.6 м²/г. В качестве микрокристаллический порошка HfB₂ использовали товарный продукт квалификации «Ч» с удельной поверхностью S_{уд} = 0.35 м²/г. Температурные рентгенодифракционные исследования проводились на дифрактометре ARL X'TRA на Си К_а излучении в геометрии Брегга-Брентано на отражение. Использовалась высокотемпературная камера HTK2000 "Anton Paar" к дифрактометру. Порошок HfB₂ ровным слоем наносили на поверхность вольфрамовой пластинынагревателя. Регистрация рентгенограмм проводилась в диапазоне температур 300-1500 К в вакууме, остаточное давление в камере составляло 8·10⁻³ Па. После достижения заданной температуры следовала выдержка в течение 4 минут, далее проводили регистрацию рентгенограммы в режиме пошагового сканирования в интервале углов $2\theta = 24^{\circ} - 45^{\circ}$, шагом съёмки 0.02° и временем набора 1 секунда в точке. Для расчёта метрики ячейки в высокотемпературных съемках использовались три отражения HfB₂ - 001, 100, 101. Обработка экспериментальных данных осуществлялась методом Ритвельда. Уточнялись параметры решетки и тепловые параметры атомов. Расчёт КТР проводился в программе TEV позволяющей рассчитывать тензор 1.01, термического расширения по дифракционным данным.

Результаты и их обсуждение

На рис.1 представлены рентгенограммы исходных порошков нано- и микрокристаллического HfB₂. Диборид гафния кристаллизуется в гексагональной сингонии, пространственная группа P6/mmm. Параметры решетки синтезированного диборида гафния соответствуют данным базы файлов порошковой дифракции PDF-2 (табл.1). Оценка размеров областей когерентного рассеяния по формуле Шеррера показала, что их величина составляет 15 нм. Анализ высокотемпературных дифракционных данных показал, что нанокристаллический HfB₂ начинает интенсивно взаимодействовать остаточным кислородом воздуха при температуре более 1270 К с формированием фазы HfO₂. Остаточного давления 5-8·10⁻³ Па оказывается достаточно для

его окисления. При нагреве до 1500 К наблюдается практически полное окисление нанокристаллического HfB₂ 3a время регистрации рентгенограммы. Типичная последовательность рентгенограмм при изотермическом отжиге нанокристаллического HfB₂ при температуре 1270 К представлена на рисунке 2.

	Нанокристаллический	Микрокристаллический	PDF2 card	
	HfB_2	HfB_2	№ 000-75-1049	№ 000-38-1398
Параметр а, А	3.141	3.1396	3.1400	3.14245
Параметр	3.467	3.4714	3.4700	3.47602

Ι

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки HfB₂





Микрокристаллический диборид гафния также взаимодействует с остаточным кислородом при температуре выше 1273К, однако из-за меньшей удельной поверхности, скорость его окисления заметно ниже, чем у нанокристаллического HfB₂.



Рис. 2. Последовательность рентгенограмм при изотермическом отжиге нанокристаллического HfB₂ до 1273K

Температурные зависимости параметров решетки *а* и *с* нано и микрокристаллического HfB₂ представлены на рис.3. Экспериментальные результаты показывают, что параметры ячейки увеличиваются с ростом температуры нелинейно, т.е. КТР зависит от температуры.



Рис.3. Температурная зависимость параметров решетки *а* и *с* нано - и

микрокристаллического HfB_2

Аппроксимация температурной зависимости параметров решетки полиномом 2 степени даёт следующие выражения для микрокристаллического HfB₂:

$$a(T)=3.1348+1.4236\cdot10^{-5} T+5.1579\cdot10^{-9} T^{2}$$

 $c(T)=3.4677+1.7927\cdot10^{-5} T+4.6791\cdot10^{-9} T^{2}$,

где *а* и *с* параметры решетки в ангстремах, а Т- температура в градусах Кельвина.

При использовании линейной аппроксимации, т.е. предполагая отсутствие температурной зависимости КТР в исследуемом диапазоне температур, значения КТР составили $\alpha_a = 7.37 \cdot 10^{-6}$ и $\alpha_c = 7.48 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹ для осей *а* и *с* соответственно (табл.2). Среднее значение КТР, рассчитываемое для кристаллов гексагональной сингонии по формуле $\alpha_{ave} = \frac{2\alpha_a + \alpha_c}{3}$, составило $\alpha_{ave} = 7.41 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹.

Табл. 2 КТР (а·10⁻⁶ К⁻¹) НfB₂

	α_a	α_c	α_{ave}	Интервал температур
Нанокристаллический HfB ₂	7.40	9.88	8.23	300-1100 K
Микрокристаллический HfB ₂	7.37	7.48	7.41	300-1500 K
$HfB_{2}[8]$	_	-	7.49	300-1770 K

Значение КТР микрокристаллического HfB_2 соответствует данным [8], где на основе дилатометрических измерений в диапазоне температур 300-1770 К КТР составил $\alpha = 7.49 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹. Полученные результаты свидетельствуют о наличии анизотропии термического расширения HfB_2 - вдоль оси *с* КТР выше, чем для вдоль оси *а*.

Для нанокристаллического HfB₂ аппроксимация температурной зависимости параметров решетки полиномом 2 степени даёт следующие выражения:

$$a(T)=3.1357+1.8465\cdot10^{-5} T+3.0384\cdot10^{-9} T^{2}$$

 $c(T)=3.4694-1.4672\cdot10^{-5} T+3.1037\cdot10^{-8} T^{2}$

При использовании линейной аппроксимации в исследуемом диапазоне температур, значения КТР составили $\alpha_a = 7.40 \cdot 10^{-6}$ и $\alpha_c = 9.88 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹ для осей *а* и *с* соответственно, а средний КТР $\alpha_{ave} = 8.23 \cdot 10^{-6}$ К⁻¹ (табл.2). Таким образом, HfB₂ в нанокристаллическом

состоянии обладает бо́льшим КТР по сравнению с микрокристаллическим аналогом. Подобный характер изменения КТР у HfB₂ типичен для нанокристаллического состояния и связан с повышением поверхностной энергии материала при увеличении дисперсности.

Заключение

Методом высокотемпературной рентгенографии проведены исследования нано и микрокристаллического диборида гафния в температурном интервале 300-1500К. Установлено, что метрика ячейки увеличивается с ростом температуры нелинейно. Впервые определены коэффициенты теплового расширения HfB_2 в направлении кристаллографических осей *a* и *c*. Показано, что HfB_2 в нанокристаллическом состоянии обладает бо́льшим КТР по сравнению с микрокристаллическим аналогом. Обнаружена существенная анизотропия КТР вдоль кристаллографических осей *a* и *c* для наноразмерного HfB_2 , что указывает на преимущественный рост ангармонизма атомных колебаний в нанокристаллах в направлении оси *c*.

Литература.

[1] Simonenko E.P., Sevast'yanov D.V., Simonenko N.P, Sevast'yanov V.G, and Kuznetsov N.T. Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2013. Vol. 58. No. 14. P. 1669–1693.

- [2] Upadhya K., Yang J.M., Hoffman W.P. Am. Ceram. Soc. Bull. 1997. V. 76. P. 51-56.
- [3] Opeka M. M., Talmy., I. G., and Zaykoski J. A. J. Mater. Sci. 2004. V.39. № 19. P. 5887–5904.
- [4] Monteverde F., Bellos A., Scatteia L // Mater. Sci. Eng. 2008. A V. 485. P. 415–421.
- [5] Carenco S., Portehault D., Boissiere C., Mezailles N., Sanchez C. Chem. Rev. 2013. V. 113. № 10. P. 7981 8065.
- [6] Андриевский Р.А., Спивак И.И. Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе. Справочник. Челябинск: Металлургия, 1989. 368 с.
- [7] Серебрякова Т.И., Неронов В.А., Пешев П.Д. Высокотемпературные бориды. М.: Металлургия, 1991. 368 с.
- [8] Loehman R, Corral E, Dumm H-P, Kotula P, Tandon R. Ultra-high temperature ceramics for hypersonic vehicle applications. Sandia Report, SAND2006-2925, Albuquerque, NM; 2006.
- [9] Кравченко С.Е., Бурлакова А.Г., Шульга Ю.М., Коробов И.И., Домашнев И.А. Дремова Н.Н., Калинников Г.В., Шилкин С.П., Андриевский Р.А Журнал общей химии. 2015. Т. 85. № 5. С. 720 725.